



## Journée scientifique du CMI

Date : jeudi 25 mai 2000  
Heures : 14h00 – 17h30  
Lieu : BM 5 202

### Programme :

- 14h00-14h15 Introduction  
*Ph.Renaud (DMT-IMS), Ph.Flückiger (DMT-CMI)*
- 14h15-14h30 Travaux pratiques  
*G.A.Racine(DMT-CMI)*
- 14h30-15h00 ONO module for embedded EEPROMS  
*D.Bouvet (DE-LEG)*  
CMP technology using colloidal silica slurries  
*R.Joray (DE-LEG)*
- 15h00-15h30 Dispositifs à films minces ferroélectriques : défi pour la microfabrication  
*P.Muralt (DMX-LC), J.Baborowski (DMX-LC)*
- 15h30-16h00 Pause et session posters
- 16h00-16h15 Photo-ablation : applications dans le domaine des chips d'analyse  
*Prof. H.Girault (DC-LE)*
- 16h15-17h00 Procédés galvaniques et fabrication de micro miroirs  
*S.Schweizer (DMT-IMS)*  
Gravure Si par plasma et fabrication de micro pompes  
*S.Gamper (DMT-IMS)*  
Résine épaisse et fabrication de compteurs de cellules  
*M.O.Heuschkel (DMT-IMS)*
- 17h00-17h30 Apéritif et session posters